

イオンミリング装置 ArBlade 5000

Ion Milling System ArBlade 5000

ついにクラス最速の断面ミリングレート を達成。
高スループット断面ミリングによって、
電子顕微鏡用の断面試料作製がさらに身近に!



The most advanced ion milling system for producing exceptionally high-quality cross-section or flat-milling samples for electron microscopy.

特長 Feature

- 断面ミリングレート 1 mm/h^{※1} 到達!
イオンビームのさらなる高電流密度化を
図った新開発のPLUSIIイオンガンにより
ミリングレートが大幅に向上^{※2}しました。

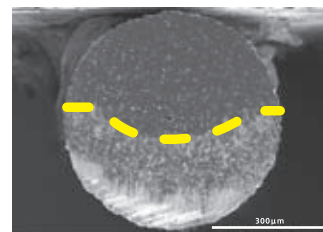
※1 マスクエッジからSiを100 μm突出させて1時間加工した際の最大深さ
※2 当社製品 (IM4000PLUS : 2014製) 比で2倍のミリングレートを実現

Cross-section milling rate : 1 mm/hour !^{※1}

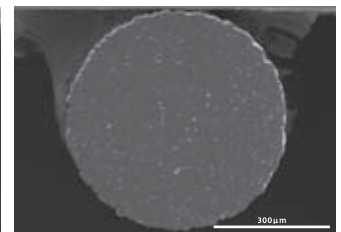
Milling rate greatly improved by high current density of the ion beam.^{※2}

※1 This rate is the maximum depth processed for 1 hour when Si is protruded 100 μm from the mask edge.

※2 Milling rate is two times greater than that of Model IM4000Plus.



IM4000PLUS



ArBlade 5000

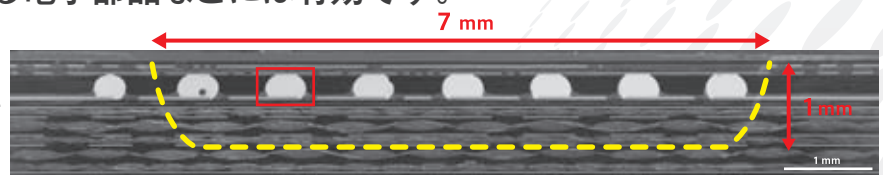
Comparison of cross-section milling
(Specimen : lead for mechanical pencil, Milling time : 1.5 hours)

- 断面ミリング幅を最大8 mmまで拡張!

ワイドエリア断面ミリング機能により断面ミリング幅を最大8 mmまで拡張できるので、
広領域ミリングが必要とされる電子部品などには有効です。

Cross-section widths up to 8 mm !

It is possible to expand milling width up to 8 mm with the wide area cross-section milling function.
The function is suitable for electronic device samples.

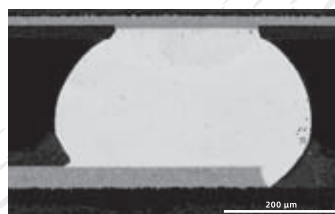


- ハイブリッドタイプ
多様なアプリケーションニーズに対応するため、断面ミリング/
フラットミリングの各モードを
搭載可能です。

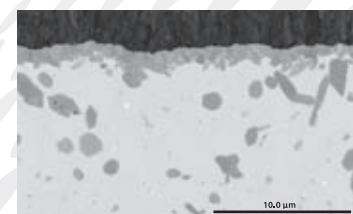
※フラットミリング®は、日本国内における
株式会社日立ハイテクノロジーズの登録商標です。

Hybrid Model

The ArBlade 5000 is the latest hybrid ion-milling system, in the Hitachi Argon Ion Milling System family of preparation equipment [IM4000 + systems].



Enlarged of the red frame



Enlarged of the left image

Example of wide-area cross-section milling
(Specimen : electronic component, Milling time : 5 hours)

